

わき出し分布法による任意形状物体まわりの後流場シミュレーションに関する研究

愛媛大学工学部 正員 中村孝幸
愛媛大学大学院 学生員 模本太司

1. まえがき： 近年、陸上及び海洋構造物は複雑多様化しつつあり、これらの物体まわりの流れを予測することが必要とされるようになってきている。そして、特にこのような構造物まわりの渦発生を含む流体現象の解明が大きな課題となっている。本研究では、一様流中及び物体中に1つの網目を置いた場合の円柱まわりの流れをわき出し分布法により求め、解析解と比較することでこれらの流れに対するわき出し分布法の適用性を検証し、さらに任意形状物体として一様流中の正方ひし形柱まわりの流れについても検討してみた。そして、これらの結果を応用して複数網目モデルによる一様流中の正方ひし形柱まわりの後流場の数値シミュレーションを行なった。

2. わき出し分布法による流体場の表示

1)複素速度ポテンシャルの表示： 流体中に物体がある場合、その物体の複素速度ポテンシャル U は物体のない場合の流れの複素速度ポテンシャル U_{main} と物体の存在によって誘起される流れのそれとの和で与えられる。そして、わき出し分布法によるとならば上述の値は(1)式のように表示できる。

$$U_R(Z) = \frac{1}{2\pi} \oint_C D(Z) \log(z-Z) dC \quad (1)$$

ここに、 $D(Z)$ は物体表面上の点 $Z (=x+iy)$ におけるわき出しの強さであり、 $Z (=x+iy)$ はポテンシャルを求めようとする点の座標である。

2)わき出し分布関数 $D(x,y)$ の決定： 任意形状物体まわりの流れの複素速度ポテンシャル U による流れは、物体表面における条件（物体が物体中に透過しない）を満足すべきであり、これを式で示すと(2)式となる。

$$U_{(x,y)} n_x + V_{(x,y)} n_y = -\frac{1}{2} D(x,y) - \frac{1}{2\pi} P.V. \oint_C D(x,y) \frac{(x-x')n_x + (y-y')n_y}{\sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2}} dC(x,y) \quad (2)$$

ここに、 $U(x,y)$ は流体中において物体がない場合の物体表面位置 (x,y) に誘起される x 軸方向の速度、 $V(x,y)$ はその y 軸方向の速度であり、 n_x は物体表面より流体中にのみ単位法線複素数 n の x 軸方向成分で、 n_y はその y 軸方向成分である。そして、わき出し分布関数 $D(x,y)$ は(2)式により決定されることになる。

3)方程式の数値化： 任意形状物体を対象にする時、(2)式の積分方程式は、解析的に取り扱うことが困難となるので物体の断面曲線を長さ ΔC_j の線素分 N 個に区分して、方程式を数値化して解いた。

4)算定結果： まず最初に上記の手法の妥当性を検証するため解析解の知られてる円柱まわりの流速分布をわき出し分布法により求めた。これを示すのが図1、図2である。図1は一様流中の円柱まわりの流速分布を示しており、解析解とわき出し分布法による算定流速とはよく一致しているのがわかる。図2は、半径10cmの

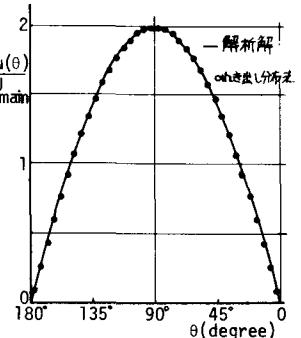


図1: 一様流中の円柱まわりの流速分布

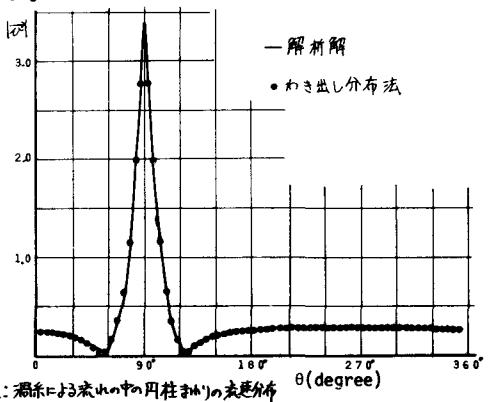


図2: 漏糸による流れ中の円柱まわりの流速分布

円柱表面より 2cm 離れた所に循環 $R = 20 \text{ cm}^3/\text{s}$ の單一の渦糸を置いた場合の円柱表面の流速分布を示すもので、解析解とめき出し分布法による算定流速とは全体的によく一致している。なお、用いた円の分割数は、 $N=72$ を採用した。以上のことをよりあきらめき出し分布法による物体まわりの流れの算定がほぼ可能であると言えよう。次に、正方ひし形柱の角をもつて曲率半径を有する円弧をモデル化し、一様流中の正方ひし形柱まわりの流速分布をめき出し分布法で求めた。これを示すのが図3である。図よりひし形の角部流速は主流速の 6 倍になってしまっており、流速の場所的変化もこの角付近で最も大きくなっていることがわかる。なお、全線素分数 $N=40$ 、角を近似する円弧の曲率半径 $r=1.0 \text{ mm}$ を用いた。

3. 後流場の数値シミュレーション：前述のめき出し分布法による物体まわりの流れの表示法と複数渦糸モデルを用いて、一様流中の正方ひし形柱まわりの後流場の数値シミュレーションを行なってみる。

1) 渦糸の運動方程式：九個の渦糸を含む非定常流中に任意形状物体が置かれていると仮定した場合、渦糸の運動が他の渦糸からしか影響を受けないことより、 m 番目の渦糸の運動学的な方程式は、(3), (4) 式で求められる。

$$\frac{d\chi_m}{dt} = U_{\text{main}}(\chi_m, \gamma_m) + \sum_{j=1}^m \frac{R_j}{2\pi} \frac{-(\gamma_m - \gamma_j)}{(\chi_m - \chi_j)^2 + (\gamma_m - \gamma_j)^2} + \sum_{j=1}^m D(\chi_j, \gamma_j) \frac{(\chi_m - \chi_j)}{(\chi_m - \chi_j)^2 + (\gamma_m - \gamma_j)^2} \Delta C_j \quad (3)$$

$$\frac{d\gamma_m}{dt} = V_{\text{main}}(\chi_m, \gamma_m) + \sum_{j=1}^m \frac{R_j}{2\pi} \frac{(\chi_m - \chi_j)}{(\chi_m - \chi_j)^2 + (\gamma_m - \gamma_j)^2} + \sum_{j=1}^m D(\chi_j, \gamma_j) \frac{(\gamma_m - \gamma_j)}{(\chi_m - \chi_j)^2 + (\gamma_m - \gamma_j)^2} \Delta C_j \quad (4)$$

ここに、 (χ_m, γ_m) は m 番目の渦糸の位置である。

2) 渦糸の循環の強さの決定：渦糸の循環の強さは、境界層理論に基づく $\Omega_{\text{BC}} = 0.5 D_B^2$ より (5) 式で与えられる。

$$\Omega(t) = 0.5 D_B^2 \Delta t \quad (5)$$

ここに、 D_B は $(t-\Delta t)$ の時間ステップにおいて発生した渦糸の初期位置より主流側に壁面より離れた距離分だけ離れた地点の流速を用いた

3) 渦糸の発生位置の決定：はく離点の確定してある物体を対象とする時、渦糸の初期位置は、はく離点における物体表面上の流速をとどめるように渦糸を置くという Kutta 条件⁹ が利用でき、これを用いて渦糸の発生位置を決定した。

4) 算定結果：前述の手本に基いて一様流中の正方ひし形柱まわりの後流場の数値シミュレーションを行なった。これを示すのが図4である。図において、●は負の循環を有する渦糸の位置を示し、×は正の循環を有するものを示す。なお、正方ひし形の全線素分数は $N=52$ で、非対称渦を発生させるため渦糸の発生するはく離点に相当するひし柱の角を図に向て上側では曲率半径 $r=0.9 \text{ mm}$ の円弧で、下側では曲率半径 $r=1.0 \text{ mm}$ の円弧で近似した。図4より、渦糸はめき出しが物体の上下より交互に行なわれるといふのがわかる、上記してきたような手法に基づき、後流場を含む任意形状物体まわりの流れをあらわすことが可能と考えられる。しかし、算定モデルにおいて実体力学的な係数の効果は十分考慮されていないので、今後これらのことと実験的な検討を含めて、考慮していただきたい。

[参考文献] 1) 今井功、流体力学(前編)，昭和48.11, P291.

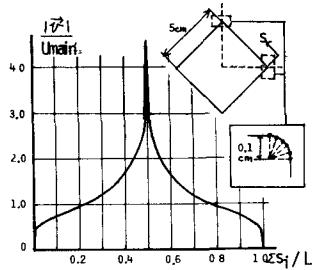


図3: 一様流中の正方ひし形柱まわりの流速分布
もこの角付近で最も大きくなっていることがわかる。なお、全線素分数 $N=40$ 、角を近似する円弧の曲率半径 $r=1.0 \text{ mm}$ を用いた。

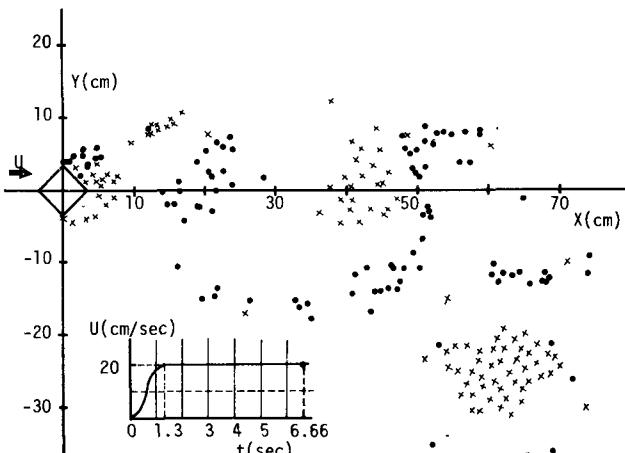


図4: 静止よりはじまる定常流中の正方ひし形柱まわりの渦糸の分布図